

## SECCIÓN C — SECCION C — QUIMICA; METALURGIA

### C25 PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS; SUS APARATOS [4]

**C25F PROCESOS PARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUS APARATOS** (tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por procesos electroquímicos C02F 1/46; protección anódica o catódica C23F 13/00) [2]

#### Nota(s) [2]

En esta subclase, se aplica la regla del último lugar, es decir en cada nivel jerárquico, salvo que se indique lo contrario, la clasificación se realiza en el último lugar apropiado.

<b>1/00</b>	<b>Limpieza, desengrasado, decapado o descascarillado por vía electrolítica [2, 2006.01]</b>	3/14	. . Localmente [2, 2006.01]
1/02	. Decapado; Descascarillado [2, 2006.01]	3/16	. Pulido [2, 2006.01]
1/04	. . en solución [2, 2006.01]	3/18	. . de metales ligeros [2, 2006.01]
1/06	. . . de hierro o acero [2, 2006.01]	3/20	. . . de aluminio [2, 2006.01]
1/08	. . . de metales refractarios [2, 2006.01]	3/22	. . de metales pesados [2, 2006.01]
1/10	. . . de actínidos [2, 2006.01]	3/24	. . . de hierro o acero [2, 2006.01]
1/12	. . en baños fundidos [2, 2006.01]	3/26	. . . de metales refractarios [2, 2006.01]
1/14	. . . de hierro o acero [2, 2006.01]	3/28	. . . de actínidos [2, 2006.01]
1/16	. . . de metales refractarios [2, 2006.01]	3/30	. . de materiales semiconductores [2, 2006.01]
1/18	. . . de actínidos [2, 2006.01]		
<b>3/00</b>	<b>Grabado o pulido electrolítico [2, 2006.01]</b>	<b>5/00</b>	<b>Levantado electrolítico de capas o revestimientos metálicos [2, 2006.01]</b>
3/02	. Grabado [2, 2006.01]		
3/04	. . de metales ligeros [2, 2006.01]	<b>7/00</b>	<b>Elementos estructurales, de células o sus ensambles para la eliminación electrolítica de materia en objetos</b> (tanto para revestimiento como para eliminación electrolíticos C25D 17/00); <b>Operación o servicio [2, 2006.01]</b>
3/06	. . de hierro o acero [2, 2006.01]		
3/08	. . de metales refractarios [2, 2006.01]		
3/10	. . de actínidos [2, 2006.01]	7/02	. Regeneración de los baños [2, 2006.01]
3/12	. . de materiales semiconductores [2, 2006.01]		